

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 4 区分
 【発行日】平成 19 年 2 月 15 日 (2007.2.15)

【公開番号】特開 2001-181820 (P2001-181820A)
 【公開日】平成 13 年 7 月 3 日 (2001.7.3)
 【出願番号】特願 平 11-372088
 【国際特許分類】

C 2 3 C 14/00 (2006.01)

C 2 3 C 16/44 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/00 B

C 2 3 C 16/44 J

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 12 月 26 日 (2006.12.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

内部を減圧状態にすることが可能な反応室と、
 前記反応室の外部に設けられ、前記反応室に接続された排気手段と、
 前記反応室の内部に設けられたゲッター手段とを有し、
 前記ゲッター手段は、Ti、Ta、Mo、Nb、Ba から選ばれた一種または複数種の元素から成るフィラメントと、前記フィラメントの加熱手段と、を有することを特徴とする薄膜作製装置。

【請求項 2】

請求項 1 において、前記フィラメントを覆うシャッターを設置し、前記シャッターの開閉が可能であることを特徴とする薄膜作製装置。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、前記反応室がスパッタ成膜をする手段を備え、前記フィラメントの蒸発に際し、前記フィラメントが、前記反応室内においてターゲットまたはホルダーから防着板で遮蔽される位置に設けられることを特徴とする薄膜作製装置。

【請求項 4】

請求項 1 または請求項 2 において、前記反応室がスパッタ成膜をする手段を備え、前記フィラメントの蒸発に際し、前記フィラメントからの蒸発物が前記反応室内においてターゲットに付着することを防げる位置に、前記フィラメントが設けられることを特徴とする薄膜作製装置。

【請求項 5】

請求項 1 または請求項 2 において、前記反応室が CVD 成膜をする手段を備え、前記フィラメントが、その蒸発に際し、前記反応室内においてホルダーまたは電極板から防着板で遮蔽される位置に設けられることを特徴とする薄膜作製装置。

【請求項 6】

請求項 1 または請求項 2 において、前記反応室が真空蒸着成膜をする手段を備え、前記フィラメントが、その蒸発に際し、前記反応室内においてホルダー、蒸着源または膜厚モニタから防着板で遮蔽される位置に設けられることを特徴とする薄膜作製装置。

【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか 1 のゲッター手段において、それぞれ異なる組成から成る、複数のフィラメントが設置されていることを特徴とする薄膜作製装置。

【請求項 8】

薄膜作製装置の反応室の排気手段として、前記反応室の外部に設けられ、前記反応室に接続された排気手段で真空引き しながら、

前記反応室内に備えた、T i、T a、M o、N b、B a から選ばれた一種または複数種の元素から成るフィラメントを通電加熱し、蒸発を一度もしくは繰り返し行 うことを特徴とする薄膜作製装置の使用方法。